

EUV-Planspiegel, 13,5 nm, 25,4 mm Durchm., 5° AOI



Extreme Ultraviolet (EUV) Flat Mirrors

Produkt **#38-759** 10 In Stock

-

1

+

€2.750⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€2.750,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Flat Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

25.40 ±0.25

Durchmesser (mm):

6.35 ±0.508

Dicke (mm):

Rückseite:

Commercial Polish	
90	Freie Apertur (%):
Fine Ground	Kanten:
3	Parallelität (Bogenminuten):

<5 RMS	Oberflächenrauheit (Angström):
--------	--------------------------------

Optische Eigenschaften

Metal/Semiconductor	Art der Beschichtung:
Mo/Si Multilayer Top Layer: Silicon	Beschichtung:

λ 10 @ 632.8nm	Oberflächenebenheit (P-V):
13.18 - 13.68	Wellenlängenbereich (nm):

13.5	Designwellenlänge DWL (nm):
Single Crystal Silicon	Substrat: □

5	Einfallswinkel (°):
R _{abs} >60% @ 13.5nm, 5° (s-pol)	Beschichtungsspezifikation:

10-5	Oberflächenqualität:
>60	Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%):

0.50	Halbwertsbreite FWHM (nm):
------	----------------------------

Elektronische Spezifikationen

92	Zentralenergie (eV):
----	----------------------

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
----------	-------------------------

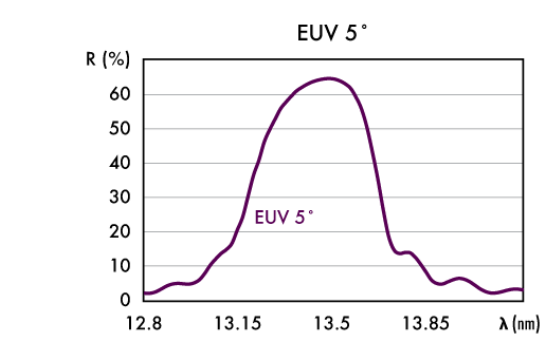
Produktdetails

- Maximal erreichbare Reflexion bei 13,5 nm
- Entwickelt zur EUV-Strahlumlenkung und Abtrennung von Oberwellen
- Versionen für 5° und 45° Einfallswinkel erhältlich

TECHSPEC® Planspiegel für extremes Ultraviolett (EUV-Planspiegel) sind mehrlagige Spiegel mit maximaler Reflexion bei der Designwellenlänge und im Design-Einfallswinkel. Diese Spiegel besitzen eine Beschichtung, die auf einem superpolierten Monokristallsiliziumsubstrat aufgebracht wird und weisen eine Oberflächenrauheit von unter 3 ÅRMS auf. Spiegel für 45° Einfallswinkel werden zur Umlenkung von s-polarisiertem Licht eingesetzt, während Spiegel für 5° Einfallswinkel mit nicht polarisiertem Licht verwendet werden. Anwendungen für EUV-Spiegel sind beispielsweise die Bildverarbeitung mittels kohärenter Beugung (CDI) und die Werkstoffforschung. TECHSPEC Planspiegel für extremes Ultraviolett (EUV) eignen sich auch zur Abtrennung von Oberwellen aus Laserstrahlen mit starker Oberwellenerzeugung (HHG).

Bitte beachten Sie: Testdaten für ein Muster des Spiegels aus jedem Fertigungslauf sind im Lieferumfang miteingeschlossen.

Technische Informationen



Kompatible Halterungen

;